

# 自然科学研究機構分子科学研究所装置開発室装置有償利用等要項

平成25年9月30日

分子科学研究所長決定

## (趣旨)

第1 この要項は、自然科学研究機構分子科学研究所（以下「研究所」という。）装置開発室で管理する装置の有償利用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

## (定義)

第2 この要項において「装置の有償利用等」とは、研究所の装置を利用する者（以下「利用者」という。）が有償で別紙に掲げる装置を利用すること及び技術支援を受けることをいう。

## (申請)

第3 利用者は、別紙の1から18までの装置については別記様式第1号による申請書を、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業（以下「ナノプラットフォーム事業」という。）の一環として管理する別紙の19及び20までの装置については別記様式第2号又は第3号による申請書を、あらかじめ研究所長に提出しなければならない。

## (許可)

第4 研究所長は、第3による申請書の提出があった場合は、装置開発室長及び関係者の意見を聴き、適当と認めたときは、別記様式第4号により、利用を許可するものとする。

## (報告書)

第5 利用者は、装置の利用を終了したときは、ナノプラットフォーム事業成果公開の場合を除き、その終了の日から1カ月以内に別記様式第5号による報告書を、研究所長に提出しなければならない。

## (実施確認)

第6 装置開発室の担当者は、利用者が装置の利用を終了したときは、速やかに別記様式第6号による実施確認書を研究所長に提出しなければならない。

## (知的財産権の取扱い)

第7 利用者が、装置を利用して得られた研究成果による発明等に係る知的財産権（「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ及びその他一切の知的財産権をいう。）の取扱いは、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程（平成16年自機

規程第12号)に定めるところによる。

(使用料等)

第8 利用者は、別に定めるところにより装置の使用料等を納付しなければならない。

(遵守事項)

第9 利用者は、研究所の規則、関係法令及び指示等を遵守するとともに安全の確保に努めなければならない。

(損害賠償)

第10 利用者は、故意又は重大な過失により、研究所の施設・設備等を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11 この要項の実施に関し必要な事項は、装置開発室長が別に定める。

附 則

この要項は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和2年1月1日から施行する。

附 則

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

## 別紙

## (装置)

	装置名称	メーカー、型式等
1	電子ビーム描画装置	エリオニクス ELS-G100
2	小型2源RFスパッタ装置 (デポダウン式)	クライオバック RSP-4-RF3×2
3	NCフライス	マキノ AEV-74
4	CNC旋盤	マザック SQT100MY
5	ワイヤー放電加工機	ファナック α-C400iB
6	5軸同時加工機	ファナック α-D21LIB5
7	工作加工機械類 放電加工機	SODICK A35R
8	マシニングセンター	マキノ BN5-85A6
9	3D測定顕微鏡	オリンパス STM6DF
10	走査型電子顕微鏡	キーエンス VE8800
11	非接触3次元測定装置	三鷹 NH-3SP
12	プリント基板加工機	ACCURATE A427A
13	オシロスコープ	岩通 DS-5354
14	ファンクション・ジェネレータ	Tektronix AFG3251
15	卓上NCフライス加工機	オリジナルマインド SR200
16	レーザーマーカ	Panasonic LP-GS051-L
17	LCRメータ	NF ZM2353
18	ロジックアナライザ	テクトロニクス TLA5201
以下、ナノプラット事業の一環として管理する装置		
19	3次元光学プロファイラ	ZYGO Nexview
20	マスクレス露光装置	ナノシステムソリューションズ DL-1000 (付属装置) スピンコーター ミサ MS-A100 マスクアライナー ミサ MA-10

## (技術支援)

区分	内容
技術開発	実験装置、制御機器等の開発、設計製図、製作、技術指導などを行う。
設計製作	実験部品、回路基板、マイクロデバイス等の設計製図、加工、製作、技術相談などを行う。
技術補助	機械、測定機、機器等の取扱説明・利用補助などを行う。

## 装置開発室装置有償利用申請書

年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構  
分子科学研究所長 殿

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。  
また、実施にあたり、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関  
においてすべての責任を負うことを誓約します。

## 記

申請者	氏名			
	所属・職名			
	住所	〒		
	連絡先	TEL e-mail		
研究課題名				
利用希望装置				
利用希望期間	年 月 日 ~ 年 月 日			
利用希望時間数	時間			
放射線業務従事	<input type="checkbox"/> 有 (注) 有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。 <input type="checkbox"/> 無			
寒剤の利用	ヘリウム： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 窒素： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
利用の目的				
利用の具体的方法				
共同利用研究者		氏名	所属	職名
	1			
	2			

	3			
	4			
	5			
不正防止に関する誓約	<p>申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーナーシップ、二重投稿等）を行いません。</p> <p>（１）研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成２６年８月２６日文科科学大臣決定）  <a href="http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf">http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf</a></p> <p>（２）大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針（平成２０年２月２８日決定）  <a href="https://www.nins.jp/site/rule/1024.html">https://www.nins.jp/site/rule/1024.html</a></p> <p>（３）大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成２０年２月２８日自機規程第７４号）  <a href="https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf">https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf</a></p> <p>以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。  <input type="checkbox"/> 誓約します。</p>			
安全管理に関する誓約	<p>申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド（<a href="https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf">https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf</a>）を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。</p> <p>以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。  <input type="checkbox"/> 誓約します。</p>			
希望事項				

申請者の所属機関における承認（※）	承認者氏名	
	所属・部署	
	職名（役職）	

※申請者の所属機関が本申請を承認していることについてご記入ください。

以下担当者記入欄

装置開発室長	担当者	区分	職員対応時間（見込）
		<input type="checkbox"/> 技術開発	時間
		<input type="checkbox"/> 設計製作	時間
		<input type="checkbox"/> 技術補助	時間

## 装置開発室装置利用申請書（ナノプラット事業成果公開）

年 月 日

分子科学研究所長 殿

所属 住所（〒 ）

職名 電話

ふりがな F A X

氏名 e-mail

企業種別(\*)： 大企業 中小企業 その他 分野・業種等(\*)：

\*・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施に当たって、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負うことを誓約します。

## 記

1. 研究課題名：

2. 利用を希望する設備と利用期間

マイクロストラクチャー  3次元光学プロファイラー ZYGO NexView  
製作・評価支援： マスクレス露光装置 NanoSystem Solutions DL-1000  
(付属装置) スピンコーター  MS-A100  
マスクアライナー  MA-10

利用期間： 年 月 日 ～ 年 月 日

利用日数及び時間数： 日間 ( 時間)

※利用期間は1か月以内とすること。

※利用日数及び時間数（見込み）については、最大の数字を記入すること。

3. 放射線業務に従事することの有無 有 無

(注) 有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。)

4. 研究目的と実施計画：

各項目についてA4判縦1枚(2ページ)に入るように記述し、添付してください。

1) 研究目的(500～1000字程度)

分子科学における当研究の意義付けを含めて、平易かつ簡潔に記載してください。

継続して申請する場合、これまでの研究経緯と本研究で新規に目指す内容について具体的に記載してください。

2) 研究の実実施計画(1000字～2000字程度)

この研究を分子科学研究所で実施することの必要性を含めて、具体的に記入してください。

5. 研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合、氏名、所属及び職名

区分	氏名	所属	職名
申請者			
1			
2			
3			
4			
5			

同伴者は5名まで可能です。申請者のほかに共同利用研究者に含める同伴者を記入してください。

6. 不正防止に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。

(1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

(平成26年8月26日文科科学大臣決定)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/26/08/\\_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568\\_02\\_1.pdf](http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf)

(2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針  
(平成20年2月28日決定)

<https://www.nins.jp/site/rule/1024.html>

(3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成20年2月28日自機規程第74号）

<https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf>

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

7. 安全管理に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (<https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf>) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

上記の装置利用の申込みを承認する。

所 属：

職 名：

氏 名：

上記は、申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを承認できる方の所属、職名及び氏名(申請者本人は不可)を記入の上、捺印ください。

記載不要	ナノプラットフォーム事業 実施責任者	装置開発室長	担当者

**【企業種別基準】**

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの

中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの

その他 上記に該当しないもの

**【分野・業種等一覧】**

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／25 その他



装置開発室装置利用申請書（ナノプラットフォーム事業成果非公開）

年 月 日

分子科学研究所長 殿

所属 住所（〒 ）

職名 電話

ふりがな FAX

氏名 e-mail

企業種別(\*)： 大企業 中小企業 その他 分野・業種等(\*)：

\*・・・本様式末尾記載の基準及び一覧から選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。

また、実施に当たって、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負えることを誓約します。

記

1. 研究課題名：

2. 利用を希望する設備と利用期間

マイクロストラクチャー  3次元光学プロファイラー ZYGO NexView

製作・評価支援： マスクレス露光装置 NanoSystem Solutions DL-1000

(付属装置) スピンコーター  MS-A100

マスクアライナー  MA-10

利用期間： 年 月 日 ~ 年 月 日

利用日数及び時間数： 日間 ( 時間)

※利用期間は1か月以内とすること。

※利用日数及び時間数（見込み）については、最大の数字を記入すること。

3. 放射線業務に従事することの有無 有 無

(注) 有の場合は「放射線業務従事承認書」を提出してください。)

4. 研究の具体的方法

## 5. 希望事項

## 6. 研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合、氏名、所属及び職名

区分	氏名	所属	職名
申請者			
1			
2			
3			
4			
5			

同伴者は5名まで可能です。申請者のほかに共同利用研究者に含める同伴者を記入してください。

## 7. 不正防止に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）、及びそれ以外の不正行為（不適切なオーサiership、二重投稿等）を行いません。

(1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

(平成26年8月26日文科科学大臣決定)

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/26/08/\\_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568\\_02\\_1.pdf](http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/_icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf)

(2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針  
(平成20年2月28日決定)

<https://www.nins.jp/site/rule/1024.html>

(3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程（平成20年2月28日自機規程第74号）

<https://www.nins.jp/uploaded/attachment/1226.pdf>

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

## 8. 安全管理に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (<https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf>) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

上記の装置利用の申込みを承認する。

所 属：

職 名：

氏 名：

上記は、申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを承認できる方の所属、職名及び氏名(申請者本人は不可)を記入の上、捺印ください。

記載不要

ナノプラットフォーム事業 実施責任者	装置開発室長	担当者

### 【企業種別基準】

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの

中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの

その他 上記に該当しないもの

### 【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／25 その他

大学共同利用機関法人自然科学研究機構  
分子科学研究所長

下記のとおり、装置開発室装置有償利用を許可します。

## 記

利用者（申請者）	
利用者所属	
共同利用研究者人数	
課題番号	
研究課題	
利用装置	
利用期間	
利用時間数又は日数	
使用料（見込み）	_____円（消費税込） ※この金額は見込みであり、実際の使用料は請求書により別途通知します。 （内訳）
許可条件	① 利用に当たっては、善良な管理者の注意をもって当てること。 ② 第三者に貸与しないこと。 ③ 実験施設を破損したときは、損害賠償を行うこと。 ④ その他使用に当たっては、研究所の指示に従うこと。
その他	① 使用に当たり、研究所の指示に従わない場合においては、利用許可を取り消すことができるものとする。 その場合、既利用分については使用料を支払わなければならない。 ② 成果公開の場合を除き、装置開発室又はナノプラット事業担当者の指示に従い、別記様式5号による利用報告書を期限までに提出すること。

別記様式第5号

装置開発室装置利用報告書

年 月 日

分子科学研究所長 殿

報告者 所 属 :  
職 名 :  
氏 名 :

下記のとおり装置の利用結果を報告します。

記

利用した装置 :

---

研究課題 :

---

共同利用研究者 : (所属・職名・氏名)

---

利用日 : 年 月 日 ~ 年 月 日

---

分子研担当者 :

利用内容 :

記載不要

ナノプラットフォーム事業 実施責任者	装置開発室長	担当者

装置開発室装置有償利用の実施確認について

年 月 日

確認者（装置開発室担当者）  
 所属  
 職名  
 氏名

下記のとおり、装置開発室装置有償利用を実施したことを確認しました。

記

利用者（申請者）			
利用者所属			
共同研究者を含めた 装置の利用人数	人		
研究課題			
課題番号			
利用装置			
利用期間 (不連続の場合は全て記入)	開始：	年 月 日 時 分	
	終了：	年 月 日 時 分	
利用日数及び時間数			
区分／担当者 ／職員対応時間数	技術開発	担当者：	時間
	設計製作	担当者：	時間
	技術補助	担当者：	時間
その他			